



































まとめ (装置が3~5年後はどうなっているかも念頭に)

- 0.3mm厚のSi基板上にm>6(d=4.8nm)のモノクロメー ター (d=4.65~4.95nm)を製作し反射率0.79を達成。
 - →さらにスタックすることで実効反射率0.88が達成。
 - →膜応力の制御とスタック方法を工夫して、反射性能 の向上と共集光化を目指す
 - →MINE3の可能性(出来るだけ労力少なく、中性子 利用のすそ野を広げる。新規パワーユーザー獲得)
- 2経路を完全分離可能なGap200µmの多層膜中性子干 渉計が達成。→J-PARC BL05と連携、AC効果の測定 を進めつつさらなる高度化を目指す。

2009 年8月4日拡大IRT研究会(小角·反射率 分科会) 山田ホール@東大物性研(東海)





